

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第2区分
【発行日】平成24年2月23日(2012.2.23)

【公開番号】特開2006-72326(P2006-72326A)
【公開日】平成18年3月16日(2006.3.16)
【年通号数】公開・登録公報2006-011
【出願番号】特願2005-193666(P2005-193666)
【国際特許分類】

G 0 3 F 7/11 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

【F I】

G 0 3 F 7/11 5 0 1

H 0 1 L 21/30 5 6 5

H 0 1 L 21/30 5 1 5 D

G 0 3 F 7/20 5 2 1

H 0 1 L 21/30 5 7 5

【誤訳訂正書】

【提出日】平成23年12月26日(2011.12.26)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0108

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0108】

スタック形成

バリアー性能を測定するために、ウェーハを、60nm厚さの市販の有機反射防止層で被覆し、215 で硬化させ、次いでメタクリレート系193nmフォトリソレジストを被覆した。次いで、トップコート層の堆積の前にレジストを任意にソフトベークした。 トップコート層の堆積の前にイソプロパノールを、ウェーハに任意に適用して予備湿潤させ、及びレジストの表面を洗浄した。 トップコート層の堆積後、フィルムを90 又は120 の温度で1分間ソフトベークした。